## SOLUTION OF CHITOSAN IN DILUTE SULFURIC ACID AND ITS PRODUCTION

Patent number:

JP7330808

**Publication date:** 

1995-12-19

Inventor:

KOBAYASHI MASAYUKI; ISE HIROSHI; SEKI MITSUTAKA; TSUCHIDA SHINYA; YAMANAMI

TAKANORI; HORIGUCHI SHOJIRO

Applicant:

DAINICHISEIKA COLOR CHEM

Classification:

- international:

- european:

Application number: JP19940144088 19940603 Priority number(s): JP19940144088 19940603

C08B37/08

Report a data error here

## Abstract of JP7330808

PURPOSE:To prepare a solution by dissolving chitosan in a dilute sulfuric acid of a specific concentration, thus isolating the fine particles of chitosan through simplified procedures in no need of expensive reagents. CONSTITUTION:This solution is prepared by dissolving chitosan in dilute sulfuric acid of 0.5-30wt.% concentration. Chitosan is brought into contact with or mixed with the dilute sulfuric acid at least 50 deg.C and a mixture of chitosan with the dilute sulfuric acid is heated up to 50 deg.C to form into a solution. The amount of the sulfuric acid is 0.2-10, preferably 0.8-4 fold molar amount based on the amino groups in chitosan. The concentration of chitosan is 0.5-15wt.% in the dilute sulfuric acid. The solution is cooled down below 50 deg.C to cause precipitation of the fine particles of chitosan.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-330808

(43)公開日 平成7年(1995)12月19日

(51) Int.Cl.6 C08B 37/08

識別記号

庁内整理番号 7433-4C

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平6-144088

(22)出願日

平成6年(1994)6月3日

(71)出願人 000002820

大日精化工業株式会社

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

(72)発明者 小林 誠幸

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

大日精化工業株式会社内

(72)発明者 伊勢 浩志

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

大日精化工業株式会社内

(72)発明者 関 光孝

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

大日精化工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 吉田 勝広 (外1名)

最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 キトサンの希硫酸水溶液及びその製造方法

### (57)【要約】

【目的】 加熱溶液を冷却することによってキトサンを 微粒子として析出させることができるキトサンの希酸水 溶液及びその製造方法の提供。

【構成】 加熱希硫酸水溶液にキトサンを溶解して得ら れるキトサンの希硫酸水溶液。



10

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 キトサンが0.5~30重量%濃度の希 硫酸に溶解してなることを特徴とするキトサンの希硫酸 水溶液。

【請求項2】 キトサンと少なくとも50℃の希硫酸を 接触させることを特徴とするキトサンの希硫酸水溶液の 製造方法。

【請求項3】 キトサンと少なくとも50℃以上の希硫 酸とを混合する請求項2に記載のキトサンの希硫酸水溶 液の製造方法。

【請求項4】 キトサンと希硫酸の混合物を少なくとも 50℃に加熱する請求項2に記載のキトサンの希硫酸水 溶液の製造方法。

【請求項5】 希硫酸の濃度が0.5~30重量%であ る請求項2に記載のキトサンの希硫酸水溶液の製造方

【請求項6】 硫酸の量がキトサンのアミノ基量の0. 2~10倍モルである請求項2に記載のキトサンの希硫 酸水溶液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はキトサンの希硫酸水溶液 及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】キチンを脱アセチル化して得られるキト サンは、そのユニークな性質を利用して種々の分野への 応用が試みられている。例えば、医療分野では創傷被覆 剤として、化粧品分野では粉体特性の改良剤として、塗 料分野では増粘剤、分散剤あるいは被膜形成剤として等 の利用が試みられている。

【0003】特に化粧品の分野では、パウダー化粧品の 粉体特性改良剤として微粒子状のキトサンに対する要望 が強い。キトサンは、希酸水溶液に常温で溶解すること はよく知られている。また、サリチル酸、リン酸等の水 溶液には難溶性であるが、加熱すると溶解するが、冷却 してもキトサンは析出せずに安定な水溶液のままで存在 することもよく知られている。これらの水溶液から固体 粒子状のキトサンを単離するには、凍結乾燥や噴霧乾燥 \*等の費用のかかる方法が必要であり、粒子状のキトサン を得ることは容易ではない。

【0004】特公昭51-6720号公報には、キトサ ンは濃硫酸に溶解するが、キトサンは硫酸化キトサンに 変化しキトサンそのものは回収することができないこ と、また、0~30℃の温度で溶解することも必要であ り、30℃を越えるとキトサンは炭化分解乃至キトサン の構成糖そのものが分解することが記載されている。

【本発明が解決しようとする課題】本発明者等は、溶液 からキトサン微粒子を容易に析出させ、単離できるキト

キトサンを溶解しない数少ない代表である希硫酸に特定 の条件下ではキトサンが溶解し、この溶液からキトサン 微粒子を容易に析出させ、単離できることを知見し、本 発明を完成するに至った。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、キトサ ンが0.5~30重量%濃度の希硫酸に溶解してなるこ とを特徴とするキトサンの希硫酸水溶液が提供される。 また、本発明によれば、キトサンと少なくとも50℃の 希硫酸とを接触させることを特徴とするキトサンの希硫 酸水溶液の製造方法が提供される。

[0007]

【作用】少なくとも50℃の特定濃度の希硫酸とキトサ ンを接触させることにより、キトサンが希硫酸に溶解し た溶液が得られる。また、この溶液を冷却することによ って徴粒子状のキトサンが析出する。

[0008]

【好ましい実施態様】以下に好ましい実施態様を挙げて 本発明を更に詳しく説明する。本発明において使用する 20 キトサンは、カニ、エビ、昆虫等の甲殻あるいはキノコ 等に含まれている天然高分子物の一種であるキチンの脱 アセチル化物であり、2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコースを1構成単位とする塩基性多糖類である。こ のような脱アセチル化キチンであるキトサンは、既に工 業的に生産されており、種々のグレードのものが入手で きるが、脱アセチル化度は約70~80%程度である。 本発明においては脱アセチル化度は特に制約はない。ま た、キトサンの分子量も特に制約はない。用途に応じて キトサン徴粒子に要求される特性を満足するように、最 適な脱アセチル化度や分子量を適宜選択すればよい。

【0009】本発明において使用する希硫酸は、キトサ ンを変質させずに溶解させるには、濃度が0.5~30 重量%の範囲で、硫酸の使用量はキトサンのアミノ基に 対して0.2~10倍モルであるのが好ましい。0.2 倍モル未満ではキトサンは溶解し難く、10倍モルを越 える加水分解による低分子量化が激しくなり好ましくな い。好ましくは0.8~4倍モルである。

【0010】本発明においてキトサンを希硫酸に溶解さ せるには、少なくとも50℃の希硫酸を使用することが 必要である。50℃未満ではキトサンは溶解し難い。9 0℃以上となると褐色に着色してくるので好ましくな い。好ましくは60~80℃である。キトサンを希硫酸 に溶解させるには、キトサンと50℃以上に加熱した希 硫酸とを混合しても、キトサンと希硫酸を混合してから 混合物を50℃以上に加熱してもよい。キトサンの濃度 は特に制約されないが、通常、希硫酸溶液中0.5~1 5重量%である。

【0011】このようしてキトサンの希硫酸水溶液が得 られる。この溶液を50℃未満に冷却することにより、 サンの溶液を得るべく種々検討した結果、希酸の中では 50 微粒子状のキトサンが析出する。本発明では、希硫酸に

BEST AVAILABLE COPY

3

溶解したキトサンは、使用する硫酸の量(濃度)によってキトサンもしくはキトサンの硫酸塩またはこれらの混合物である。従って、キトサン微粒子を硫酸塩の形で使用することが不都合な場合には、単離した微粒子を公知のアルカリ水溶液で中和すれば本来のキトサンとすることができる。

## [0012]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に 説明する。特に断らない限り実施例中の%は重量基準で ある。

#### 実施例1

5リットルのセパラブルフラスコに、キトサン (0.5% ) 機度、粘度1500cps、脱アセチル化度75%) 240gとイオン交換水3600gを入れ、攪拌しなが695% 濃硫酸290gを添加した。添加終了後、フラスコの内容物を加熱して80℃に昇温するとキトサンは溶解し、本発明のキトサンの硫酸水溶液が得られた。そのまま1時間保持した後、グラスフィルターで熱時濾過して不溶解分を除去し、濾過液を室温まで冷却するとキトサンが微粒子状に折出した。

【0013】 実施例2

5 リットルのセパラブルフラスコに、キトサン(1 %濃

度、粘度10cps、脱アセチル化度98%)240gとイオン交換水3600gを入れ、攪拌下に95%濃硫酸150gを添加した。添加後、内容物を加熱して60℃に昇温するとキトサンは溶解し、本発明のキトサンの硫酸水溶液が得られた。実施例1と同様にして遮液を室温に冷却するとキトサンが微粒子状に折出した。

## 【0014】 実施例3

5リットルのセパラブルフラスコに、キトサン (0.5 % 濃度、粘度1000cps、脱アセチル化度85%)

10 240gとイオン交換水3600gを入れ、攪拌下に95% 濃硫酸220gを添加した。添加終了後、フラスコの内容物を加熱して80℃に昇温するとキトサンは溶解し、本発明のキトサンの硫酸水溶液が得られた。実施例1と同様にして濾液を室温に冷却するとキトサンが微粒子状に折出した。

## [0015]

### フロントページの続き

(72)発明者 土田 真也

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号 大日精化工業株式会社内 (72)発明者 山南 降徳

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号 大日精化工業株式会社内

(72)発明者 堀口 正二郎

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号 大日精化工業株式会社内

PEST AVAILABLE COPY